

CSVG 混氢臭氧水系统

是用于生产浓度可控的溶解氢和臭氧的高纯水系统。这个装置能用于半导体和显示器生产中无化学品的表面清洗。这是一个混合装置，能够一边生产浓度可控的溶氢水，一边生产溶有臭氧的DI水。每一个输出最大可达100升每分钟。

特点及优点

- 氢和臭氧在同一台设备中
- 化学品的生态友好型替代者
- 节约化学品及运输成本
- 占地面积小
- 高浓度大流量
- 带HMI界面的触摸屏
- 对显示器生产的一体化解决方案

选项

- 多种流量多种浓度
- 计算机网络支持
- SECS II / GEM支持

构造

- 中空纤维膜接触
- 溶氢水单元100slpm/1ppm
- 臭氧水单元100slpm/25ppm
- PLC控制
- 高纯PFA气动阀
- 液晶触摸屏显示
- 无金属沾污



混合发生器

对显示器生产的复合系统

- 双臭氧+氢
- 100%无化学品
- 无金属沾污
- 大流量
- 小尺寸



Manufacturer of Equipment
for the Semiconductor Industry

CSVG Group a.s.
The Science and Technology Park
of Palacký University in Olomouc
Slechtitelu 21
783 71 Olomouc
Czech Republic
E-Mail: martin.s@csvg.eu
Telephone: +420 739 245 043